PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-276882

(43) Date of publication of application: 06.12.1986

(51)Int.CI.

C09K 9/02

(21)Application number: 60-120049

(71)Applicant: UNITIKA LTD

(22) Date of filing:

03.06.1985

(72)Inventor: HOSODA MASAHIRO

OKUDA KAZUHIDE

WATANABE YASUMITSU

(54) PHOTOCHROMIC LAMINATE

(57)Abstract:

PURPOSE: A photochromic laminate, obtained by forming a polyorganosiloxane based cured film containing a specific compound on an organic plastic material and having improved coloring performance, reverse rate, light resistance, adhesion, surface hardness and scuff resistance.

CONSTITUTION: A laminate obtained by forming a polyorganosiloxane based cured film containing a spironaphthoxazine compound expressed by the formula (R is lower alkyl; X1 and X2 are H, OH, lower alkoxy or halogen; X3 and X4 are H, lower alkyl, lower alkoxy, halogen, nitro or cyano) on an organic plastic material. USE: Light-shielding materials for lenses of eyeglasses, windows of buildings, automobiles, streetcars, aircraft,

etc., instrument panels, showcases, etc., and display materials, materials for actinometers, photometers, optical filters, decorations, etc.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-276882

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)12月6日

C 09 K 9/02

6755-4H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

⑤発明の名称 フォトクロミック積層体

②特 願 昭60-120049

②出 願 昭60(1985)6月3日

⑫発 明 者 細 田 雅 弘 宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 ⑫発 明 者 奥 田 和 秀 宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 ⑫発 明 者 渡 辺 康 光 宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内

①出 願 人 ユニチカ株式会社 尼崎市東本町1丁目50番地

明 細 書

1. 発明の名称

フォトクロミック積層体

2.特許請求の範囲

(1) 有機プラスチック材料に

一般式(1)

(式中, Rは低級アルキル基, X, X, は水 素原子, 水酸基, 低級アルコキシ基, 又はハ ロゲン原子, X, X, は水素原子, 低級アル キル基, 低級アルコキシ基, ハロゲン原子, ニトロ基又はシアノ基を表わす) で示される 化合物を含有せしめたポリオルガノシロキサ ン系硬化被膜が形成されてなるフォトクロミ ック積層体。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光照射により吸収スペクトルが可逆的に変化する現象、すなわち、フォトクロミズムを示し、かつ、発色性能、戻り速度、耐光性、密 着性、表面硬度、耐振係性において優れたフォト クロミック積層体に関するものである。

(従来の技術)

フォトクロミズム現象に着目した商品は、現在、 無機ガラス系で展開されており、メガネレンズ、 自動車のサンルーフ等に利用されている。この無 機ガラス系では、フォトクロミック物質に、主と してハロゲン化銀を用い、耐光性及び戻り。 とこれた性質が得られている。しかし、これ らの物質は、色変化の幅があまり大点があった。 を安全性、軽量といった面でも欠点があった。 た安全性、軽量といった可では、安全性、軽力 の面から有効な機能を備えた有機プラスチック材料の開発が望まれている。

このような背景から本発明者らは、フォトクロ

ミック有機プラスチック材料の検討を行ってきた。 それによれば、ハロゲン化銀で代表される無機フォトクロミック物質は、有機合成樹脂との相容性が悪く、有機合成樹脂系に用いることは不可能であった。また、有機合成樹脂との相容性に優れたスピロビラン類、ジチゾン錯体類、トリフェニルメタン類等の有機フォトクロミック物質は、一般に戻り速度が遅いうえ、耐光性にも問題があった。

戻り速度、耐光性を改良したフォトクロミック 物質としては、スピロナフトオキサジン誘導体. (特開昭 5 5 - 3 6 2 8 4 号公報) が知られている。上記引例は、フォトクロミックプラスチックレンズの製品化を目指したものであり、該スピロナフトオキサジンのジエチレングリコール溶液にプラスチックレンズを浸漬し、昇温加熱して、該化合物を含有させるものであった。

(発明が解決しようとする問題点と解決方法)

引例に記載された溶液染色法は、充分な変色を 生ずるに必要な染着率が得られにくいという決定 的な欠点のほかに、コスト高及び染色廃液処理の

子、水酸基、低級アルコキシ基、又はハロゲン原子、X3,X4 は水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基又はシアノ基を表わす)で示される化合物を含有せしめたポリオルガノシロキサン系硬化被膜が形成されてなるフォトクロミック積層体である。

本発明における有機プラスチック材料とは、フィルム、シート状物、樹脂成型物等を意味し、名間であるの材料には、ナイロンも無色透明であるの材料には、ナイロン11. 対していてもよい。これらの材料には、ナイロン11. ナイロン66. ナイロン46. ナイロン7 セナイレース、ポリアセナルロース、ポリアセナルリール、ポリアセン、ポリアセン、ポリアン、ポリアリート、ポリカーボネート、ポリアリルメタフリレート、ポリカーボネート、ポリアリカーボネート、ポリアリカーボネーテルサルホン、ポリスチレン、ポリイミド、ポリフェニンスルフィド等

困難など様々の問題を含み、また、この方式でつくられるプラスチックレンスには、 表面の耐擦傷性を高めるため、ハードコート処理が不可欠である。

本発明者らは、かかる状況に鑑み、優れた発色性と充分な表面硬度を有するプラスチックレンズを提供することを目的として、鋭意研究した結果、スピロナフトオキサジン化合物とポリオルガノシロキサン系樹脂から成る被膜を形成させることにより、上記の目的が達成しうることを見出し、本発明に到達した。

以下,本発明の実施態様について詳述する。本 発明におけるフォトクロミック積層体は、有機プ ラスチック材料に下記一般式 (1)

(式中、Rは低級アルキル基、Xi,Xi は水素原

を挙げることができる。

(I) 式における低級アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基が、低級アルコキン基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基が、またハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素原子を挙げることができる。

また、本発明におけるポリオルガノシロキサン 系硬化被膜とは、下記一般式

$$R^{1}_{a} \longrightarrow S^{1}_{i} \longrightarrow (OR^{2})_{4-(a-b)}$$

(ただし、R¹,R* はおのおのアルキル基、アルケニル基、アリル基、またはハロゲン原子、エポキシ基、アミノ基、メルカプト基、メタクリロキシ基及びシアノ基を有する炭化水素基、R* は炭素数が1~8のアルキル基、アルコキシアルキル基、アシル基であり、aおよびbは0.1または2であり、かつ、a+bは1または2である。)であらわされる化合物、もしくはその加水分解物を

硬化して得られる被膜であって、そのような化合 物の例としては、メチルシリケート、エチルシリ ケート、ロープロピルシリケート、ユープロピル シリケート、n-プチルシリケート、t-プチル シリケート、ェープチルシリケートなどのテトラ アルコキシシラン類、メチルトリメトキシシラン、 メチルトリリエトキシシラン。メチルトリメトキ シエトキシシラン、メチルトリアセトキシシラン. メチルトリプトキシシラン。エチルトリメトキシ シラン, エチルトリエトキシシラン, ピニルトリ メトキシシラン、ピニルトリエトキシシラン、ピ ニルトリアセトキシシラン、ピニルトリメトキシ エトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、 フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリアセ トキシシラン、ャークロロプロピルトリメトキシ シラン、ァークロロプロピルトリエトキシシラン、 r-クロロプロピルトリアセトキシシラン、3.3. 3-トリクロロプロピルトリメトキシシラン。 ァ -メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン。 ァーアミノプロピルトリメトキシシラン、ァーア

ミノプロピルトリエトキシシラン. ェーメルカプ トプロピルトリメトキシシラン。ァーメルカプト プロピルトリエドキシシラン, Ν-β (アミノエ チル) - r - アミノプロピルトリメトキシシラン, β - シアノエチルトリエトキシシラン、メチルト リフェノキシシラン、クロロメチルトリメトキシ シラン、クロロメチルトリエトキシシラン、グリ シドキシメチルトリメトキシシラン。グリシドキ シメチルトリエトキシシラン、α-グリシドキシ エチルトリメトキシシラン。α-グリシドキシェ チルトリエトキシシラン。 B - グリシドキシエチ ルトリメトキシシラン、β-グリシドキシエチル トリエトキシシラン、αーグリシドキシプロピル トリメトキシシラン、α-グリシドキシプロピル トリエトキシシラン、β-グリシドキシプロピル トリメトキシシラン、β-グリシドキシプロピル トリエトキシシラン、ァーグリシドキシプロピル トリメトキシシラン、ァーグリシドキシプロピル トリエトキシシラン、ィーグリシドキシプロピル トリプロポキシシラン、ャーグリシドキシプロピ

ルトリプトキシシラン、 ァーグリシドキシプロピ ルトリメトキシエトキシシラン、ェーグリシドキ シプロピルトリフェノキシシラン。 α-グリシド キシブチルトリメトキシシラン、α-グリシドキ シブチルトリエトキシシラン、B-グリシドキシ プチルトリメトキシシラン。 ァーグリシドキシブ チルトリメトキシシラン、ァーグリシドキシブチ ルトリエトギシシラン, δ-グリシドキシブチル トリメトキシシラン。8-グリシドキシブチルト リエトキシシラン、 (3、 4 - エポキシシクロへ キシル) メチルトリメトキシシラン。(3、4-エポキシシクロヘキシル) メチルトリエトキシシ ラン、β - (3, 4 - x x + y y 0 + y x y)エチルトリメトキシシラン、 8- (3.4-エポ キシシクロヘキシル) エチルトリエトキシシラン. β- (3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチル トリプロポキシシラン、B-(3、4-エポキシ シクロヘキシル) エチルトリプトキシシラン。β - (3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチルト リメトキシエトキシシラン、β- (3、4-エポ

キシシクロヘキシル) エチルトリフェノキシシラ ン, ァー(3、4-エポキシシクロヘキシル)プ ロピルトリメトキシシラン、ァー(3、 4-エポ キシシクロヘキシル) プロピルトリエトキシシラ ン、 8- (3, 4-エポキシシクロヘキシル) ブ チルトリメトキシシラン、 & - (3, 4-エポキ シシクロヘキシル) プチルトリエトキシシランな どのトリアルコキシ、トリアシルオキシまたはト リフェノキシシラン類および、ジメチルジメトキ シシラン、フェニルメチルジメトキシシラン、ジ メチルジエトキシシラン、フェニルメチルジエト キシシラン、 r - クロロプロピルメチルジメトキ シシラン、ャークロロプロピルメチルジエトキシ シラン, ジメチルジアセトキシシラン, ァーメタ クリルオキシプロピルメチルジメトキシシラン. ァーメタクリルオキシプロピルメチルジェトキシ シラン、アーメルカプトプロピルメチルジメトキ シシラン、ェーメルカプトプロピルメチルジエト キシシラン。ェーアミノプロピルメチルジメトキ シシラン, ァーアミノプロピルメチルジエトキシ

シラン、メチルピニルジメトキシシラン、メチル ピニルジエトキシシラン、グリシドキシメチルメ チルジメトキシシラン, グリシドキシメチルメチ ルジエトキシシラン、α-グリシドキシエチルメ チルジメトキシシラン、α-グリシドキシエチル メチルジエトキシシラン, β - グリシドキシエチ ルメチルジメトキシシラン、β-グリシドキシエ チルメチルジエトキシシラン。α-グリシドキシ プロピルメチルジメトキシシラン. α-グリシド キシプロピルメチルジエトキシシラン、β-グリ シドキシプロピルメチルジメトキシシラン、β-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン. ァーグリシドキシブロピルメチルジメトキシシラ ン、ァーグリシドキシプロピルメチルジエトキシ シラン、 ァーグリシドキシプロピルメチルジプロ ポキシシラン, ァーグリシドキシプロピルメチル ジプトキシシラン、 r - グリシドキシプロピルメ チルジメトキシエトキシシラン。ァーグリシドキ シプロピルメチルジフェノキシシラン、ァーグリ シドキシプロピルエチルジメトキシシラン。ァー

グリシドキシアロビルエチルジエトキシシラン、 r - グリシドキシアロピルビニルジメトキシシラン、 r - グリシドキシアロピルビニルジエトキシ シラン、 r - グリシドキシアロピルフェニルジメ トキシシラン、 r - グリシドキシアロピルフェニ ルジエトキシシランなどジアルコキシシランまた はジアシルオキシシラン類がある。

また、これらケイ素化合物の加水分解物は、該ケイ素系化合物に塩酸、硫酸等の酸性水溶液を添加潤律することによって得られる。

これらのポリオルガノシロキサン系化合物には、 改質のために各種樹脂、好ましくはメラミン系樹脂組成物、あるいはエポキシ系樹脂組成物を配合することができる。ここに用いるメラミン系樹脂組成物には、水酸基を有するビニル化合物の重合体または共重合体と、エーテル化メチロールメラミンよりなる組成物が、またエポキシ系組成物にはポリオレフィン系エポキシ樹脂、シクロペンタジエンオキシドやシクロペキセンオキシド、あるいはペキサヒドロフタル酸、フタル酸、イソフタ

なお、改質のために配合する上記樹脂組成物の配合量は、SiOxとして計算されたポリオルガノシロキサン系化合物 1 0 0 重量部に対し 1 0 ~ 2 5 0 重量部、好ましくは 1 0 ~ 1 5 0 重量部が望ましい。

本発明における該スピロナフトオキサジン化合物の使用量は、ポリオルガノシロキサン系被膜形成性組成物100重量部に対し、5~100重量部、好ましくは10~50重量部である。該スピロナフトオキサジン化合物の含有量が5重量部以下になると、充分な色変化が望めない。

また、100重量部以上では、該スピロナフトオキサジン化合物の結晶が折出し、被膜表面が白濁化する。ポリオルガノシロキサン系被膜形成性組成物と該スピロナフトオキサジン化合物とからなるフォトクロミック性硬化被膜の厚みは0.05~50μm,好ましくは1~20μmが望ましい。0.05μm以下では充分な表面硬度を得ることは難しい。

硬化時の加熱温度は、硬化速度の点から高温が好ましいが、上限は有機プラスチック材料の熱変形温度以下、下限は50℃以上が望ましい。所要時間は、硬化温度に応じて通常10分~10時間程度である。この際、作業工程を簡略化するため 紫外線 (UV) 照射を用いることもできる。硬化

速度をコントロールするため、開始剤、増感剤等 を有効に利用することもできる。

該スピロナフトオキサジン化合物を含んだポリオルガノシロキサン系被膜形成組成物の塗布手段としては、スピンコーティング法、スプレー法、 浸漬法、フローコーティング法、パーコーティン が法等を用いることができる。

特に、有機プラスチック材料とフォトクロミック性ポリオルガノシロキサン系被膜との接着性が問題となる場合には、あらかじめ有機プラスチック材料に各種エッチング、薬品処理、放電処理、カップリング剤処理などの化学的・物理的・機械的予備処理を施すことも有効である。

(発明の効果)

本発明のフォトクロミック積層体は、従来知られている染色法を用いた材料よりも優れた発色性能が得られるだけでなく、大面積化も容易であるため、上述のプラスチックメガネレンズだけでなく、建築物、自動車、電車、飛行機などの窓、あるいは計器パネル、ショーケースなどに日光遮断

A : 1 cm × 3 cm の範囲内に全然傷がつかない。

B:上記範囲内に1~10本の傷がつく。

C:上記範囲内に10~100本の傷がつく。

D: 無数の傷がついているが、平滑な妻面が 残っている。

B: 表面についた傷により平滑な表面は残っていない。

- c) 表面硬度:鉛筆硬度試験 (JIS-K-5400) によった。
- d) 発色性能:光照射による活性化状態での最大吸収波長 (6 1 3 nm) の光学密度の変化 (Δ O D) を測定した。
- e) 戻り速度:暗所における完全戻り時間を測 定した。
- () 耐光性: JIS-L-0824規格の耐光 試験機を用い、20時間露光後の発色 保持率を測定した。ここで発色保持率 とは次式で定義されるものである。

材料として用いることができる。また、ディスプレイ材料、光量計、光学計、光学フィルター、装飾などの材料としても有効に利用できる。

以下に本発明をさらに具体的に説明するために 実施例を挙げる。

(実施例)

本発明における各特性の測定法、判定基準は次の通りである。

- a) 密着性: クロスカットテープテストによる。 すなわち、被膜表面にナイフで1 mm × 1 mm のマス目を100個つくり、その上にセロテープ(積水化学社製)をはりつけた後、そのセロテープを剝離して100個のマス目のうち剝離しないマス目の個数をもって表示した。 (密着性試験 JIS-D-2020)
- b) 耐擦傷性:供試試料の表面を#〇〇〇〇番 のスチールウールで1kg/cdの荷重を かけながら10往復摩擦し、傷のつい た度合を下の段階に分けて評価した。

発色保持率(%)

20時間露光後の光照射による飽和光学密度 初期の光照射による飽和光学密度 × 1 0 0

実施例1~3,比較例1,2

(1) エチルシリケート加水分解物溶液の調製イソプロピルアルコール70gにエチルシリケート100gを溶解し、さらに0.05規定塩酸水溶液30gを加えて、室温で攪拌して加水分解を行った。反応初期に白濁していた系は、反応の進行に伴い透明になった。反応後常温で20時間以上熟成した。得られた溶液はSi0zとして計算されたポリオルガノシロキサン系化合物14.4%を含んでいた。

(2) 改質剤の合成

ブチルアクリレート40gと2-ヒドロキシエチルメタアクリレート10gとAIBN0.5gを300gのエチルアルコールに溶解し、窒素雰囲気下70℃で5時間加熱攪拌して重合させた。

反応終了後内容物を石油エーテル中に注ぎ、 未反応モノマーを除去してビニル共重合体を 得た。

(3) フォトクロミック性を有するポリオルガノ ノシロキサン系被膜形成性組成物の作成 1.3.3 - トリメチルスピロ(インドリン-2.3 → (3 H) - ナフト(2, 1 - b) -1.4 - オキサジン)と、前述のポリオルガ ノシロキサン溶液、ピニル共重合体、ヘキサ (ブトキシメチル)メラミン、添加物及び溶 剤を第1表に示した割合で混合し、均一溶液 として試料を作成した。

(4) 塗装及び性能評価

2 四厚のポリアリルジグリコールカーボネート樹脂(PPG社、CR-39)のシート 状物を水、アセトンで超音波洗浄を行った後、 上記(3)で得られた試料を浸漬法により塗 布し、80℃2時間熱風乾燥を行い硬化させ た。得られたCR-39板に対し性能評価を 行った。その結果を第1表に示す。

共栄社油脂化学社製),及び添加物を第2表に示した割合で混合し、均一溶液として試料を作成した。

(3) 塗装及び性能評価

実施例1と同様にして、CR-39板に塗布し、120℃2時間熱風乾燥を行い硬化させた。得られたフォトクロミック性CR-39板に対し性能評価を行った。その結果を第2表に示す。

比較例 4

ジエチレングリコール120重量部に1.3.3

-トリメチルー9'-メトキシースピロ(インドリン-2.3' — (3 H) -ナフトー(2.1-b)
-1,4-オキサジン)5重量部を溶解させ、120

でに加熱した。次に、この溶液中に2m厚のCR
-39板を1時間30分浸漬した材料に対し、上

記と同様な測定を行った。その結果を第3衷に示すが、本発明によって得られた材料は、染色法によって得られた材料は、次のではないて非常

実施例 4~6. 比較例 3

(1) r - グリシドキシプロピルトリメトキシシランとテトラメトキシシランの加水分解物溶液の調整

ァーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン110g,テトラメトキシシラン80gをイソプロピルアルコール230gに溶解させ、さらに室温で0.05N硝酸水溶液76gを加え、1時間攪拌して加水分解を行った。その後、攪拌を停止して室温で20時間以上熟成した。得られた溶液はSi0xとして計算されたポリオルガノシロキサン系化合物11.8%を含んでいた。

(2) フォトクロミック性を有するポリオルガノ シロキサン系被膜形成性組成物の作成

1.3.3 - トリメチルスピロ(インドリン-2.3 - (3 H) - ナフト-(2.1 - b) -1.4 - オキサジン)と前述のポリオルガノシロキサン溶液、1.6 - ヘキサンジオールジグリシジルエーテル(エポライト1600.

に優れている。

特許出願人 コニチカ株式会社

特開昭61-276882(ア)

						1	第 1							
		4 9 4 8 8 / ジロキサン 溶液 (重量部)	ピニル 共庶合体 (重量部)	ユータル化 メチロールメラミン (重量部)	スピロナフト オ キ サ ダ ン (重量部)	添加物 (重量部)	溶剂	A 101	密替性	耐烧傷性	便 皮	発色性能 (AOD)	戻り速度 (秒)	耐光性 (%)
実施例	F 1	100	20	10	8	IN規定 坦 酸 2	酢 酸 40 n-ブタト8・20 キシレン10	良 好	100	В	4 H	0.71	9 0	7 2
•	2	100	6	6	5	•	•	•	100	A	5 H	0.68	9 0	. 68
	3	100	10	6	3	•	•	•	100	A	4 H	0.59	9 0	60
比較的	1	100	. 1	0	4	•	•	ひびわれ	. 9 T	В	3 Ң	0.63	7 0	3 7
	2	100	6	6	1	•	7.	•	100	A	5 H	0.21	9 0	4 8

第 2 表												
	\	ポリオルガノ シロキサン溶液 (重量部)	ジグリシジ ルエーテル (重量部)	スピロナフト オ キ サ ジ ン (重 量 部)	添加物 (銀貨部)	外 18	密着性	耐蚀保性	硬 皮	発色性能 (AOD)	戻り速度(砂)	耐 光 性 (%)
実施例	4	100	21	7.2	塩化第一双 1	良 奶	100	В	4 H	0.92	100	61
•	5	100	15	6	•	•	100	A	5 H	1.03	90	57 .
	6	100	15	5	•	•	100	A	5 н	0.89	90	53
•	7	100	8	3.5		. •	100	A	4 H	0.83	80	49
比較例	3	100	8	1	-	-	100	A	4 H	0. 3 2	80	25

郑 3 表

	硬 皮	発色性能 (Δ0D)	戻り速度(秒)	耐光性(%)	
実施例5	5 H	1.03	9 0	57	
比較例4	2 н	0.27	6 0	34	

特許出願人 ユニチカ株式会社